# 研究論文

# Si 系ハードコートのシンクロトロン光分析による評価

野本豊和\*1、中西裕紀\*1、加藤一徳\*2

# Analysis of Hard Coat Film Containing Organosilane by Synchrotron Light

## Toyokazu NOMOTO<sup>\*1</sup>, Yuuki NAKANISHI<sup>\*1</sup>, Kazunori KATO<sup>\*2</sup>

Research Support Department\*1\*2

ゾルゲル法により作製した Si 系ハードコート膜を XAFS 解析し、含まれるアルコキシシランの種類に 関して定量的な評価を行った。3 官能と 4 官能のアルコキシシランの配合比や加水分解による化学状態変 化に対応した系統的な変化が得られ、Si 系ハードコートの配合比算出だけでなく、液合成中の反応過程を 評価できる可能性を示した。

# 1. はじめに

ハードコートはプラスチックの傷付き防止といった 用途でディスプレイ等に用いられ、我々の生活に欠かせ ないものである。特にシリコン系のハードコートは取扱 いが容易で広く用いられているハードコートの一つであ る。シリコン系ハードコートの硬さは、4官能や3官能 のアルコキシシラン(有機シラン化合物)を混ぜ合わせ、 その量比で制御されており、この配合比が非常に重要で ある。アルコキシシランの配合比は核磁気共鳴(NMR)を 用いて分析することが最も有効であるが、液状でなくて は測定が難しい等、実際の固体状態のハードコート膜を 分析する上では問題がある。

そこで本研究では、Si系ハードコート膜中のアルコキ シシランの種類ごとの定量や、その化学状態変化を評価 する為の分析技術を確立する目的で、シンクロトロン光 を利用したX線吸収微細構造測定(以下、XAFS測定)や、 高度計測分析機器を用いた各種分析を実施した。

2. 実験方法

# 2.1 分析試料

熱硬化型ハードコートの作製はゾルゲル法<sup>1)</sup>で行った。 アルコキシシラン(テトラエトキシシラン、以下 TEOS: 4 官能及び 3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 以下 GPTMS:3 官能)、水およびメタノールを混合した 後、塩酸を加えて約1日撹拌し、硬化触媒(アセチルアセ トンアルミニウム)を加えてハードコート液を作製した。 これらの配合比は表1に示すとおりである。作製したハ ードコート液をポリカ板上にスピンコートして 100℃ 約2時間加熱乾燥し、ハードコート膜を製膜した。これ らのハードコート膜について、金属顕微鏡(ECLIPSE LV150N)を用いて形態観察を行った(図1)。4 官能であ る TEOS の割合が増加するにつれて膜が平坦になるが、 TEOS のみで作製した時には割れが生じている。一方、 GPTMS の割合を増やしていくと割れは生じにくくなる が、凝集物が増加し、膜としての形成が難しくなる傾向 が見られた。形態の異なる5つのハードコート膜を評価 対象の試料とし、各分析を行った。

表1 ハードコート液の配合比

アルコキシシラン [g]		涫媒 [g]		酸触媒[µL]	硬化触媒 [g]	
TEOS (4)	GPTMS (3)	メタノール	<b>水</b>	塩酸	アセチルアセトン アルミニウム	
10	0					
7	3					
5	5	10	10	10	0.1	
3	7					
0	10					



図1 ハードコート膜の金属顕微鏡による観察像

#### 2.2 実験室系装置による分析

各ハードコート膜やその参照試料(原料や反応中途

\*1 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室 \*2 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室(現 尾張繊維技 術センター) 物)について、X 線光電子分光(以下 XPS)、顕微ラマン分光(以下 RAMAN)および飛行時間型二次イオン質 量分析(以下 TOF-SIMS)による測定を行った。

#### 2.3 シンクロトロン光を用いた分析

XAFS 測定はあいちシンクロトロン光センター BL6N1 の大気圧条件 XAFS 測定システムを用い、部分 蛍光収量法(PFY)で行った<sup>2)</sup>。シンクロトロン光は InSb (111)二結晶分光器を用いて分光し、Si の K 吸収端(1830 ~1890 eV)の領域を測定した。固体試料はカーボンテー プにより固定し、液体試料はポリエチレン製の溶液セル に封入し測定を行った。

#### 3. 実験結果及び考察

## 3.1 X 線光電子分光

表1に示すハードコート膜について Si2p 準位の XPS 測定(PHI5000 VersaProbe)を行った結果を図2に示す。 TEOS と GPTMS の比が 10:0と0:10 では 1.5 eV と いう大きなピークシフトが起きているが、その間の組成 変化では 0.3 eV 程度しかシフトが起きておらず、変化に 乏しいことが分かる。このように、Siの価数は中間の組 成ではあまり変化しないことが分かり、XPS 分析は TEOS と GPTMS の配合比の算出には有効でないと言え る。



図2 ハードコート膜の Si2p XPS スペクトル

3.2 顕微ラマン分光

同様の試料について、RAMAN 測定(NRS-5100)を行

った結果を図3に示す。TEOSとGPTMSの比が10:0 と0:10での比較を行うと、各組成で明確な違いが現れ ていることが分かる。特に GPTMS では 2900 cm<sup>-1</sup>付近 及び 900~1600 cm<sup>-1</sup>の構造に特徴があり、TEOS では 500 cm<sup>-1</sup>付近の構造が特徴的である。中間の組成である 5:5のハードコート膜は TEOS と GPTMS 両方の特長 を有するスペクトルを示しており、RAMAN スペクトル からアルコキシシランの配合の程度を推定することは十 分可能である。また、図3の最上段に10:0と0:10の 平均スペクトルを示す。TEOS と GPTMS 両方の特長を 有するスペクトルを再現できているが、実スペクトル (5:5)と比べて GPTMS のピーク強度がかなり弱くなっ ており、解析により正確な配合比を算出することは難し いと考えられる。この強度が合わない問題は、各試料に おいて膜厚が異なることが原因として挙げられ、試料作 製条件を改善する必要がある。



図3 ハードコート膜の RAMAN スペクトル 及び平均スペクトル

## 3.3 飛行時間型二次イオン質量分析

TOF-SIMS 測定(PHI TRIFT V nanoTOF)を行った結 果を図4に示す。TEOS と GPTMS の比が 10:0のハー ドコート膜のスペクトルは他の組成のものと大きく異な るが、0:10 から 7:3 ではスペクトルがほとんど変化 していないことが分かる。GPTMS を含む場合に支配的 に検出される m/z = 29、41、45の陽イオンは、それぞ れ CHO<sup>+</sup>、C<sub>3</sub>H<sub>5</sub><sup>+</sup>、C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O<sup>+</sup>に同定できる。このことから、 GPTMS の持つ炭素と酸素を含む基が非常にイオン化さ れ易く、TOF-SIMS 測定において高い感度を持つため、 少量混合しただけでもスペクトルを支配してしまうと考 えられる。このため、TOF-SIMS ではハードコート膜の 配合比に対して系統的なデータが取得できず、その解析 には不向きであることが分かった。

#### 3.4 XAFS 分析結果

#### 3.4.1 Si 系ハードコートの XAFS 分析



図5に示すのは、今回作製したハードコート膜(5種) と参照試料のSi K-edge XAFS測定の結果である。TEOS とGPTMSの比が10:0のハードコート膜のスペクトル はピーク位置がクォーツと一致しており、SiO2の状態で あることが同定できる。一方、0:10のスペクトルは2 箇所にピーク構造を持っており、低エネルギー側から順 にSi-C(約1846 eV)、Si-O(約1848 eV)の結合に起因す るものと考えられる。配合比を変化させたハードコート 試料においては、これらの2つのピーク強度が系統的に 増減している。また、ハードコートの原料となるTEOS やGPTMSのスペクトルと比べると、いずれもピーク位 置や構造が変化しており、加水分解・脱水縮合による第 2配位圏の変化も捉えることができた。



図5 パートコート展と参照試科の Si K-edge XAFS スペクトル

#### 3.4.2 XAFS スペクトルの定量解析

図5で得られた XAFS スペクトルに関して、線形結合

フィッティングにより定量的な解析を行った。その1例 を図6に示す。フィッティングはTEOSのみである10: 0および、GPTMSのみである0:10を標準スペクトル とみなし、中間の配合のハードコート膜(3点)から得ら れたスペクトルを最小二乗法により再現する方法で行っ た。算出した配合比と、表1を元に計算した仕込値 (mol%)を比較した結果を表2に示す。このように、XAFS スペクトルを適切に解析すれば、概ね数%以内の精度で 未知試料の配合比を算出できることが確かめられた。



図6 線形結合フィッティングの例

表 2	フィ	ッティ	ング	から	求め	た配合	比
-----	----	-----	----	----	----	-----	---

TEOS仕込值	TEOS算出值		
(mol%)	(mol%)		
72.6	70.7		
53.2	49.4		
32.7	32.4		

### 3.4.3 XAFS による反応過程の分析

XAFS が液体試料を容易に測定可能であることを活か し、ハードコート液を作製する過程でアルコキシシラン と水の間で起こる加水分解・脱水縮合について分析可能 かを検討した。TEOS または GPTMS を水と1:1で混 合し、容器中で十分に撹拌した後しばらくすると、水層 とアルコキシシランの層に分離するが、水層側を取出し て測定装置に組み込み、5分間隔で繰り返し XAFS 測定 を行った。結果を図7および図8に示す。TEOS を用い た場合、メインピークの強度が測定毎に増加し、ピーク 位置は高エネルギー側へシフトする傾向が見られた。最 終的なスペクトルは10:0のハードコート膜と一致して おり、TEOS が水と反応して変化したことが確かめられ た。また、5分間隔の測定で反応の中途段階も見ること ができた。

GPTMS を用いた場合、測定したスペクトルに時間変化は起きなかった。スペクトルを比較すると、原料の

GPTMS とは異なっており、0:10 のハードコート膜と 一致し、加水分解・脱水縮合後の GPTMS であることが 明らかとなった。このことから、GPTMS は水との反応 が非常に速く、水との混合後、装置に組み込み、測定を 開始する時点で既に反応が終了していたことが分かった。 よって、GPTMS の反応を XAFS 測定で追うためには、 現状のビームラインの測定システムでは厳しく、混合後、 即座に測定できる試料セルの開発が必要である。



**図7** TEOS と水の混合物の Si K-edge XAFS スペクトル (5 分間隔の測定)



**図8** GPTMS と水の混合物の Si K-edge XAFS スペクトル (5分間隔の測定)

#### 4. 結び

本研究では、ゾルゲル法により作製したSi系ハードコ ート膜について種々の分析方法により定量解析が可能か どうかを検討した。実験室系の分析については、化学状 態分析に用いられる XPS と質量分析を行う TOF-SIMS は本分析に適していないことが判明した。一方、RAMAN では各アルコキシシランの区別が明確にでき、試料作製 条件を改善すれば定量解析は十分可能であろうと推察さ れる。これに対し、シンクロトロン光を用いた XAFS で は数%程度の精度で定量解析が可能であることが分かり、 TEOS と GPTMS の配合比を正確に算出することができ た。また、XAFS を用いた場合には TEOS の加水分解過 程を時間スケールで追うことにも成功し、XAFS 分析の 応用範囲の広さを示すことができた。

#### 謝辞

本研究を遂行するにあたり、XAFS 測定でサポート頂 いたあいちシンクロトロン光センターの村井様、陰地様、 杉山様、村瀬様、また、ハードコート作製や顕微ラマン 分光でご協力頂いた山田様、村松様に厚くお礼申し上げ ます。

#### 文献

- 山田圭二,行木啓記,吉元昭二,加藤一徳:愛知県 産業技術研究所研究報告,8,52 (2009)
- 2) 野本豊和, 八木伸也, 竹田美和: 化学工学, 79, 8 (2015)